

# POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

## KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierunek studiów: Nanotechnologie i Nanomateriały

Profil: Praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod kierunku: NtiNm

Stopień studiów: I

Specjalności: Inżynieria nanostruktur

### 1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU	Podstawy prawa własności intelektualnej i przemysłowej
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM	basics of intellectual property law
KOD PRZEDMIOTU	WIMiF NTINM pIS B18 21/22
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty podstawowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	1.00
SEMESTRY	2

### 2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	LABORATORIUM KOMPUTERO- WE	SEMINARIUM	PROJEKT
2	15	0	0	0	0	0

### 3 CELE PRZEDMIOTU

**Cel 1** Poznanie systemu ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie umiejętności w zakresie wykorzystania dokumentacji patentowej w pracy inżyniera.

## 4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 brak

## 5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

**EK1 Wiedza** Uzyskanie wiedzy dotyczącej systemu ochrony własności intelektualnej.

**EK2 Umiejętności** Uzyskanie umiejętności zarządzania własnością intelektualną.

**EK3 Umiejętności** Uzyskanie umiejętności zabezpieczania wyników badań.

**EK4 Umiejętności** Uzyskanie umiejętności prowadzenia poszukiwań w bazach patentowych.

## 6 TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
<b>W1</b>	Konstytucyjne prawo do twórczości, konstytucyjna ochrona własności, ochrona dób osobistych, kodeks cywilny składniki przedsiębiorstwa, oznaczenie przedsiębiorcy	2
<b>W2</b>	Prawo autorskie pojęcie utworu, prawa osobiste, prawa majątkowe, roszczenia z tytułu naruszenia prawa autorskiego, zasady ochrony, plagiat	4
<b>W3</b>	Patenty prawo do patentu, zasady uzyskiwania patentów, przedmioty wyłączone z patentowania, postępowanie zgłoszeniowe, rodzaje patentów, SPC, system ochrony patentów, zasady ochrony patentowej, roszczenia z tytułu naruszenia patentu, sprzeciw, unieważnienie patentu, ograniczenia prawa z patentu, licencje, budowa opisu patentowego	4
<b>W4</b>	Znaki towarowe co to jest znak towarowy, zasady ochrony, systemy ochrony znaków towarowych, postępowanie zgłoszeniowe, zasady ochrony znaków towarowych, roszczenia w przypadku naruszenia znaku towarowego, sprzeciw, unieważnienie znaku towarowego - 2 Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych	2
<b>W5</b>	Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych	1
<b>W6</b>	Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, ochrona know-how, ochrona oznaczenia przedsiębiorcy, ochrona produktu	2

## 7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

**N1** Wykład

**N2** prezentacja multimedialna

**N3** Dyskusja

**N4** materiały dostępne na platformie e learningowej

## 8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
<b>Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:</b>	
Godziny wynikające z planu studiów	15
Konsultacje przedmiotowe	7
Egzaminy i zaliczenia w sesji	0
<b>Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:</b>	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	0
Opracowanie wyników	0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	8
<b>SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA</b>	<b>30</b>
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	1.00

## 9 SPOSOBY OCENY

### OCENA FORMUJĄCA

**F1** Uczestnictwo w wykładach

**F2** Praca pisemna

**F3** Zaliczenie pisemne

### OCENA PODSUMOWUJĄCA

**P1** Ocena 1

### WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

**W1** Uczestnictwo w zajęciach

**W2** złożenie pracy pisemnej

**W3** Zaliczenie pisemne

### KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.

NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach
NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybranezagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawnaodpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza sięnieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie.
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach
NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.

NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie.
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach
NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie.
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach

NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie..

## 10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKT KSZTAŁCENIA	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓLOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1		Cel 1	W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 P1
EK2		Cel 1	W3	N1 N2 N3	F1 F2 P1
EK3		Cel 1	W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 P1
EK4		Cel 1	W3 W4 W5	N1 N2 N3	F1 F2 P1

## 11 WYKAZ LITERATURY

### LITERATURA PODSTAWOWA

[1 ] Joanna Sieńczyło-Chlabicz red. — *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa, 2018, WoltersKluwer Polska

## 12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

### OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Andrzej Osak (kontakt: aosak@pk.edu.pl)

## 13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

---

(miejsowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)